

저압 MOCVD법에 의한 (100)-GaAs 기판 위의  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$  성장

전성란, 손성진, 조금재, 박순규, 김영기

전북대학교 물리학과

## I. 서 론

GaAs 에 격자정합된  $\text{Ga}_{0.51}\text{In}_{0.49}\text{P}$  는 그의 에너지 밴드갭이 상온에서 1.9eV 로써 약 650nm 의 적색광을 발광하는 레이저 다이오드의 활성층 재료 및 적색 LED 에 있어서 매우 중요한 재료가 되었다. 특히,  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}/\text{GaAs}$  물질계는 valence-band 의 큰 불연속성, GaAs 와의 계면 (interface) 에 있어서의 낮은 재결합, 에너지 띠간격이 거의 비슷한  $\text{Al}_{0.37}\text{Ga}_{0.63}\text{As}$  와 비교할 때 산화(oxidation) 가 잘 되지 않는다는 점, 그리고 deep-level 효과없는 높은 농도의 도우팅이 가능하다는 점 등의 다양한 특성을 때문에 매우 큰 관심을 갖게 되었다. 본 실험에서는 연구실에서 직접 제작한 MOCVD 장치를 이용하여 저압 MOCVD 방법에 의해 적절한 성장조건을 찾아  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}/\text{GaAs}$  를 성장시켜서 에피층의 특성을 알아 보았다.

## II. 실험 방법

본 실험실에서 직접 제작한 MOCVD 장치는 성장 압력을 저압(1 torr 이하)에서 대기압까지 용통성 있게 활용할 수 있게 하였으며 gas manifold 는 일정량의 반응 기체를 혼합시킨 다음 반응 chamber 에 유입하도록 구성하였다. 또한 시료를 성장실에 넣고 꺼낼 때, 성장실이 대기에 노출되지 않게 하기 위하여 진공 load lock system 을 설치하였다. 기판으로는  $<110> \pm 0.5^\circ$  방향으로  $2^\circ$  off 된 (100) 면을 갖는 n형 (Si-doped) 및 Cr-doping 된 GaAs 를 사용하여 수직 반응실에 의하여 성장온도  $610^\circ\text{C} \sim 690^\circ\text{C}$ , 성장압력 70 torr 에서 V/III 비를 120~220 범위에서 변화시켜 가면서 30분 또는 1시간동안 저압 MOCVD 법에 의하여  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$  를 성장하였다. MO 원료로는 TMIn 와 TEGa 을 사용하였는데 bubbler 온도가  $17^\circ\text{C}$  인 TMIn 의 유량은 0.031sccm 으로 고정시켰고 bubbler 온도가  $12^\circ\text{C}$  인 TEGa 의 유량은 0.029~0.032sccm 으로 변화시켰다. 수송 가스로써 성장에 사용한  $\text{H}_2$  의 총 유량은 2 lit/min 이다.

### III. 실험 결과

성장실의 압력이 70 torr인 저압 MOCVD 방법에 의하여 GaAs(100) 기판위에  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$ 를 성장하였다. 성장온도가 650°C, TEGa의 유량이 0.032sccm, TMIn의 유량이 0.031sccm이고 PH<sub>3</sub>의 유량이 10.64~12.16sccm 일때 즉 V/I 비가 170~192 일때 성분비 x가 0.51인  $\text{Ga}_{0.51}\text{In}_{0.49}\text{P}$  에피층을 얻었으며 이때 가장 좋은 surface morphology를 보였다.  $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}$ 의 성장률은 1.8μm/h이었다. PH<sub>3</sub>의 유량은 표면 상태, 운반자 농도와 이동도 및 PL peak 에너지의 이동에 변화를 주며 두께 변화에는 아무런 영향을 미치지 않음을 알 수 있었다. TMIn과 TEGa의 유량을 각각 0.031sccm 및 0.032sccm으로 하여 650°C에서 성장시킨 시료의 기판과의 lattice mismatch는  $|\Delta a/a| = (3.7 \sim 8.9) \times 10^{-4}$ 임을 X-선 이중결정 회절(DCXRD)법에 의해서 확인했다. PL 측정 결과, 300K와 5K에서의 PL peak 에너지는 각각 1.853eV와 1.896eV였으며 PL peak에 의해 주기-반기쌍의 재결합에 의한 에너지 방출임을 알았다. 또한 V/I 비가 증가함에 따라 PL peak 에너지는 1.86eV에서 1.81eV로 감소하였다. 실온에서의 흡광계수 측정에 의하여  $(366 \sim 1012)\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec}$ 의 전자 이동도와  $(1.88 \sim 8.18) \times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ 의 운반자 농도를 얻었다.